

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成20年2月21日(2008.2.21)

【公開番号】特開2005-277403(P2005-277403A)

【公開日】平成17年10月6日(2005.10.6)

【年通号数】公開・登録公報2005-039

【出願番号】特願2005-48298(P2005-48298)

【国際特許分類】

H 01 L 33/00 (2006.01)

H 01 L 21/28 (2006.01)

【F I】

H 01 L 33/00 E

H 01 L 21/28 3 0 1 B

H 01 L 21/28 3 0 1 R

【手続補正書】

【提出日】平成20年1月8日(2008.1.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 5 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 5 5】

【表3】

表3 Pt (222) の面間隔

コンタクトメタル層	成膜法	Pt (222) の面間隔
Pt	D C	1.128
Pt	R F	1.138